

反応工学部会CVD反応分科会主催
第22回シンポジウム「高機能保護膜の基礎と展開」

共催 CVD研究会

日時：平成26年1月29日(水) 13:10~18:00 (終了後、懇親会を開催します。)

会場：早稲田大学 西早稲田キャンパス 62W号館 大会議室

参加費：化学工学会CVD反応分科会法人会員(無料)，化学工学会CVD反応分科会個人会員(2,000円)，化学工学会反応工学部会会員(3,000円)，化学工学会会員(4,000円)，学生(無料)，CVD研究会会員(4,000円)，非会員(10,000円)

申込方法：(1)氏名，(2)勤務先(所属)，(3)連絡先E-mail，(4)参加資格(所属学会等)，(5)懇親会出欠を明記の上，Webにて，<http://www2.scej.org/cre/cvd/event.html> よりお申込み下さい。

申込締切：1月24日(金)。ただし、定員(100名)になり次第締め切ります。

プログラム

- 13:10-14:00 基調講演 明治大学 永井 一清氏
「ハイバリア性評価方法と国際標準化(仮題)」
- 14:00-14:40 大日本印刷 松井 茂樹氏
「CVD技術を用いたガスバリア性膜の開発について(仮題)」
- 14:40-15:00 休憩
- 15:00-15:40 講師未定
「(太陽電池あるいは有機デバイスにおけるガスバリア膜)」
- 15:40-16:20 講師未定
「ガスバリア薄膜技術の基礎(仮題)」
- 16:20-16:40 休憩
- 16:40-17:20 富士通セミコンダクター 恵下 隆氏
「FRAMにおける水素拡散防止保護膜(仮題)」
- 17:20-18:00 株式会社T I 高橋 善和氏
「ハイバリア膜とバリア性能評価装置(仮題)」
- 18:00-19:30 懇親会(62W号館 中会議室)

シンポジウムオーガナイザー

筑根 敦弘 (太陽日酸株式会社)、齊藤 丈靖 (大阪府立大学)、野田 優 (早稲田大学)

お問合せ：cvd@scej.org